INTELLECTUAL PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

सत्यमेव जयते

क्रमांक : 044136664
SL No :

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पेटेंट कार्यालय
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र
PATENT CERTIFICATE

(Rule 74 Of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.	:	384333
आवेदन सं. / Application No.	:	201741023752
फाइल करने की तारीख / Date of Filing	:	06/07/2017
पेटेंटी / Patentee	:	INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s)	:	1.ANUJ RAJPOOT 2.SOUMYA DUTTA

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित BI-LAYER RESIST APPROACH OF PHOTOLITHOGRAPHIC PATTERNING OVER PMMA BASED POLYMER DIELECTRICS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 6th day of July 2017 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled BI-LAYER RESIST APPROACH OF PHOTOLITHOGRAPHIC PATTERNING OVER PMMA BASED POLYMER DIELECTRICS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 6th day of July 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

एकस्य कार्यालय THE PATENT OFFICE GOVT.OF INDIA भारत सरकार

अनुदान की तारीख :
Date of Grant : 15/12/2021

पेटेंट नियंत्रक
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, **6th day of July 2019** को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 6th day of July 2019 and on the same day in every year thereafter.